

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 18 年 1 月 26 日 (2006.1.26)

【公開番号】特開 2000-21953 (P2000-21953A)
 【公開日】平成 12 年 1 月 21 日 (2000.1.21)
 【出願番号】特願 平 10-189185
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/677 (2006.01)

H 0 1 L 21/68 (2006.01)

H 0 1 L 21/22 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 D

H 0 1 L 21/68 M

H 0 1 L 21/22 5 1 1 J

【手続補正書】
 【提出日】平成 17 年 12 月 7 日 (2005.12.7)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】半導体製造装置の反応炉に配置されるポートと、ウェーハカセットとの間でウェーハの移載を行う半導体処理方法において、
 前記移載の回数が予め決められた回数に達する毎に、前記半導体製造装置に配置したオリフラ合わせ装置によって、前記ウェーハはカセットに収納したウェーハのオリフラ合わせを自動的に行うことを特徴とする半導体処理方法。

【請求項 2】ポートと、ウェーハカセットとの間でウェーハの移載を行う半導体製造装置において、
前記移載の回数が予め決められた回数に達する毎に、前記半導体製造装置に配置したオリフラ合わせ装置によって、前記ウェーハはカセットに収納したウェーハのオリフラ合わせを自動的に行うことを特徴とする半導体製造装置。